



Makple Spin Development Machine

スピン現像装置



ガラス基板を回転させながら
基板上に塗布されたレジスト膜の
現像から純水によるリンスまで
自動で処理を行います。

- 現像液パージ機構を設けており、現像液の品種替えが、容易に行えます。
- ノズル左右移動にロボットを採用。0～400mmの広範囲に対してノズルの移動が任意に設定可能。
- ノズル上下位置が0～500mmの広範囲に任意に設定可能。

■ Spin Development Machine仕様

装置サイズ	W1,200×D1,000×1,738 (mm)
現像室	SUS製 透明PVC窓付き
基板サイズ	0.7t×100×100 (mm) 基板チャック/真空吸着式 (ガイドピン付き)
基板回転	6?2,000RPM
ノズル	現像液×1ヶ、リンス3ヶ 横移動 (X軸) 可動はレシピ設定により自動で現像及びリンスを行います。 (ノズル上下位置は予め手動で設定を行います。)
現像液	ヒータとチラーによる循環方式 容量：max5L 温調：18℃?30℃±0.5℃
リンス (純水)	ヒータとチラーによる循環方式 容量：max10L 温調：18℃?30℃±1℃
液制御	PLC・タッチパネル方式

※現像液、リンス液タンクは本体に内蔵

